



LE VIDE

Généralités
Domaines de pression
Flux gazeux
Dégazage
Conductance
Régime d'écoulement
Installation type
Moyens de pompage
Moyens de mesure

https://www.ijclab.in2p3.fr/

<u>philippe.rosier@ijclab.in2p3.fr</u> Bureau études mécaniques

Le vide

un gaz raréfié ou un mélange gaz/vapeur caractérisé par une pression inférieure à la pression atmosphérique

La pression est la force exercée par les molécules de gaz sur une surface unité

$$P = F / S$$
 Unité S.I.: Pascal (N/m²)

La pression atmosphérique moyenne est environ 1013 hPa

Basées sur les principales propriétés du vide :

- ·atmosphère inerte, suppression de la contamination
- isolation thermique
- · effet « mécanique »
- · diminution des collisions entre molécules

Dans les accélérateurs et physique des particules :

- limiter les interactions du faisceau avec le gaz résiduel perte du faisceau par collision avec le gaz résiduel
- permettre le fonctionnement de systèmes spécifiques

les sources de particules les systèmes HT (cavités accélératrices HF..) les cryosystèmes (cavités HF supra, cryomagnétisme, détecteurs..)

Unités de pression usuelles

Unité S.I. : Pascal (1 Pa = 1 N/m^2)

En pratique : on utilise le mbar (le Torr, le mm Hg)

1 bar = 10^5 Pa ; 1 mbar = 100 Pa = 1 hPa; 1 Pa = 10^{-2} mbar

1Torr = 1mm Hg = 133 Pa et 1 atm = 760 Torr= 1,013 bar

Domaines de pression

Les limites doivent être considérées comme approximatives

de 10⁵ à 10² Pa : vide industriel ou vide primaire Pas d'influence des parois - régime d'écoulement turbulent ou laminaire

de 10² à 10⁻¹ Pa : vide moyen

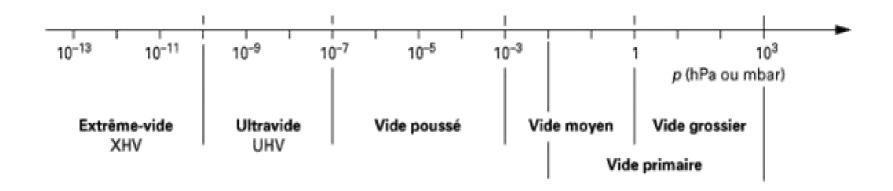
Variation de la viscosité et de K - régime laminaire ou moléculaire suivant les dimensions de l'enceinte à vide

de 10-1 à 10-5 Pa : vide poussé

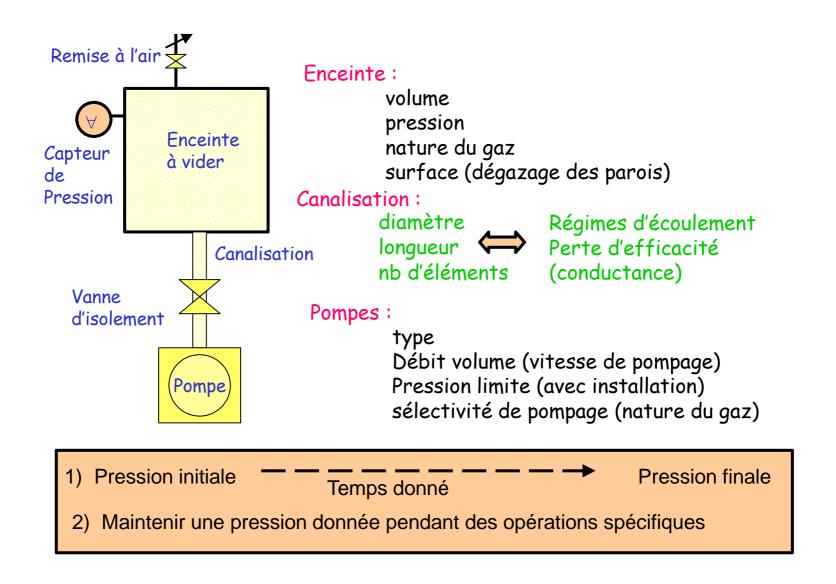
Les phénomènes de surface interviennent - régime d'écoulement moléculaire

< 10-5 Pa : ultra-vide

Domaine des faibles concentrations moléculaire - phénomènes de surface - technologie ultra-vide



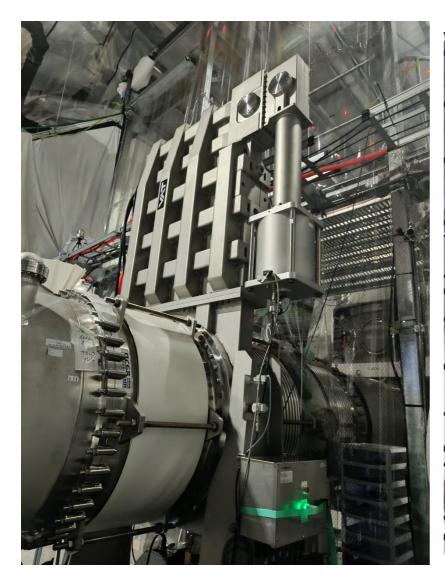
Une installation de vide



Gate valve

P = F / S

Attention à la force de pression sur les dispositifs sous vide (écrasement soufflets, force sur piquages et flambage des enceintes)





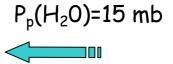
Les questions à se poser pour décrire et dimensionner une installation

- Que veut-on faire?

 pomper de l'air ... mais aussi des mélanges,
 gaz légers, inertes, réactifs, dangereux?
- Quel vide faut-il atteindre?
 les domaines du vide...et leurs techniques
- En combien de temps?
 vitesse de pompage
 les pompes mais aussi les canalisations
 => montage en fonction du domaine du vide
- Le design ?
 Brides, joints, matériaux, ...

Composition de l'air atmosphérique sec

		Concentratio n (%)	Pression partielle (mbar)
Azote	N2	78	780
Oxygène	02	21	210
Argon	Ar	0.93	9.3
Gaz carbonique	<i>C</i> 02	0.03	0.3
Néon	Ne	0.0018	1.8 10-2
Hélium	He	0.0005	5 10 ⁻³
Krypton	Kr	0.0001	1 10-3
Hydrogène	H2	0.00005	5 10-4
Xénon	Xe	0.000006	6 10 ⁻⁵



Description macroscopique: Loi des gaz parfaits

pour n moles PV = nRT

en introduisant le nb. de molécules
$$N = n N_A$$
 $(N_A = 6.02.10^{23} \text{ molecules})$ aux conditions TPN $P V = N (R/N_A) T$ cte de Boltzmann $k = 1.381.10^{-23} \text{ J/K}$ (par molécule) Soit $P V = N k T$ ou $P = n_V k T$

avec n_V densité moléculaire => la pression est proport. à la densité moléculaire ...

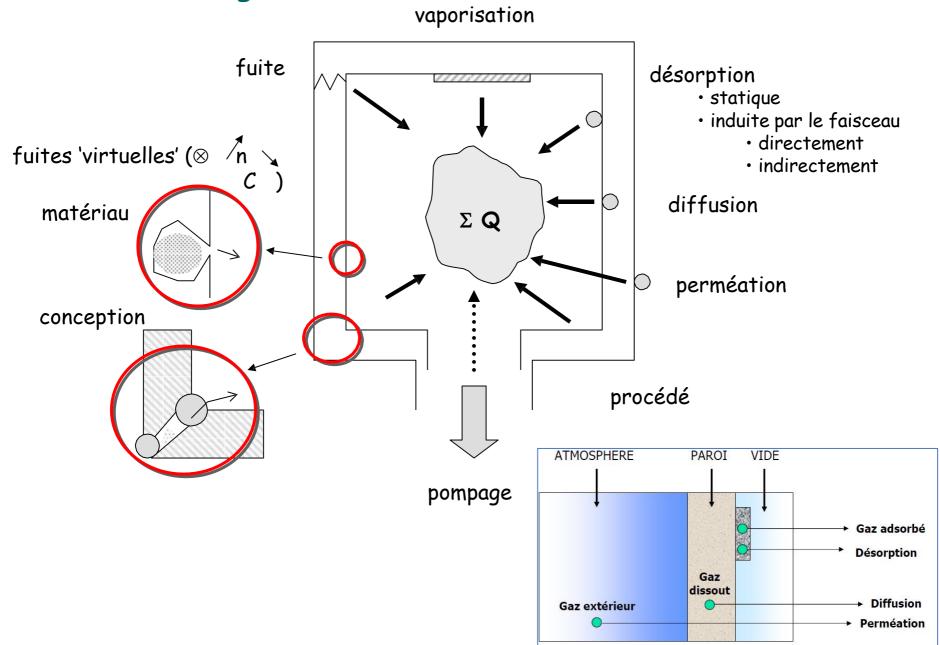
=> La notion de pression partielle est importante car les machines utilisées en technique du vide (pompes et capteurs de pressions) se comportent différemment selon la nature des gaz

^{*} la pression résulte de l'ensemble des chocs des molécules sur les parois (1 $Pa = 1 N/m^2$)

^{*} notion de pressions partielles

^{*} diminuer la pression revient à réduire le nombre de molécules ou leur vitesse (T)

Bilan des flux gazeux

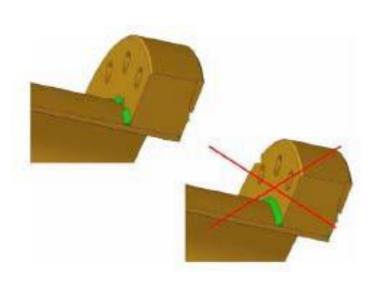


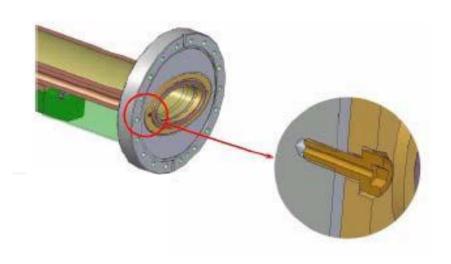
Les fuites virtuelles



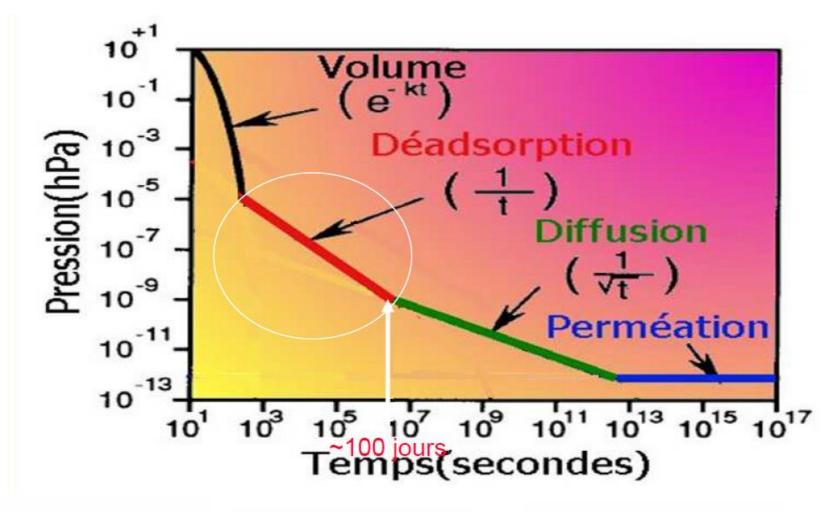


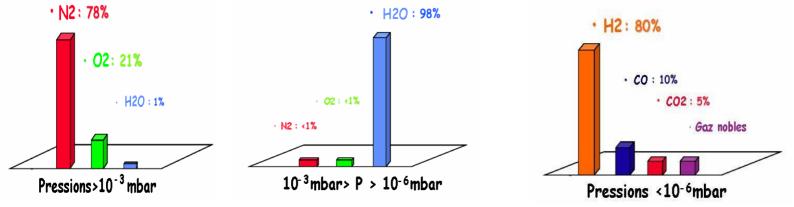
Spécifications pour la conception des ensembles mécaniques sous vide





nb de molécules dans 1 mm³ à la Pa ? 2,5. 10¹⁶ autant que dans 10 m³ à 10⁻⁷ hPa..



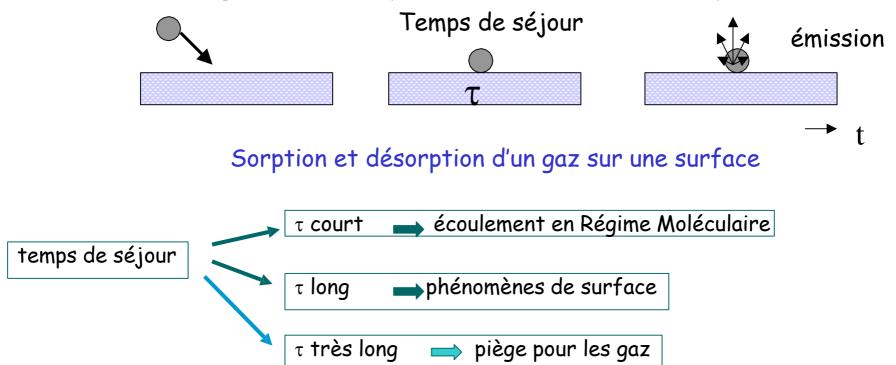


Chocs sur les parois (la particule séjourne)

Fondamental pour le calcul des écoulements gazeux à très basses pressions écoulement gazeux difficile à basses pressions (régime moléculaire)

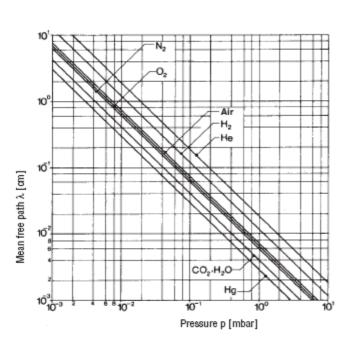
Echanges gaz-surface : adsorption / désorption

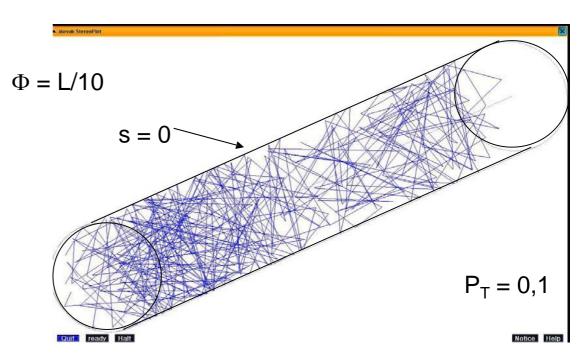
- Phénomène général observé avec tous les couples solides gaz
- · la quantité de gaz adsorbé dépend de la surface du solide, pas de son volume



Probabilité de transfert (régime moléculaire)

Simulation de la probabilité de transfert des molécules de gaz dans une structure (régime d'écoulement moléculaire)





Libre parcours moyen définition du vide lm poussé



(intéraction des molécules de gaz avec les parois, régime d'écoulement)

Absorption

Absorption des gaz par physisorption

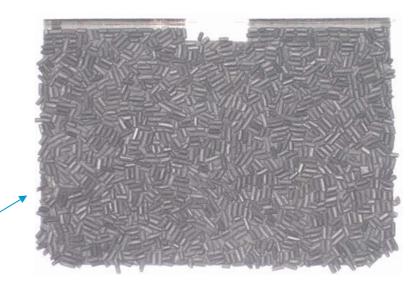


largement utilisé en technique du vide pour pièger les molécules de gaz résiduel

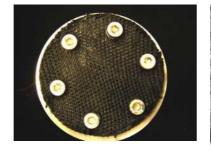
Principaux absorbants utilisés:

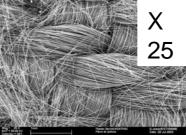
- Zéolites
- Silica-gel
- · Charbon actif

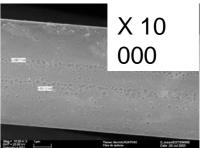
Charbon actif: le meilleur absorbant ·1000 à 1700 m²/g porosité qq diz. 10-10 m ·utilisation sous forme de batonnets (diam. 3 mm, L: 4 à 5 mm)



sous forme de fibres (V. Baglin CERN)



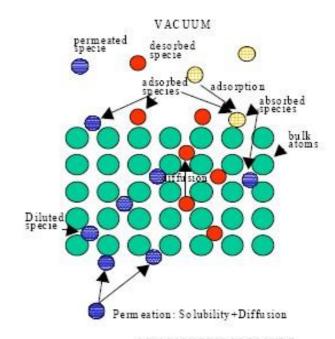




La perméation

Les corps solides ne sont pas des obstacles aux gaz. Les gaz peuvent traverser les corps solides suivant un processus complexe :

- ·Adsorption de la molécule sur la parois externe
- ·Dissociation de la molécule
- ·Dissolution dans le réseau
- Diffusion
- ·Recombinaison sur la parois interne
- ·Désorption sous vide



ATM OSPHERIC PRESSURE

Le dégazage (surtout en pompage secondaire)

Dans une installation de vide, le dégazage provient des parois plus ou moins rugueuses piègeant les molécules ou couvertes de dépôts pulvérulents, des joints élastomères, des matériaux poreux, des pièces qui sont chauffées au cours des opérations ...

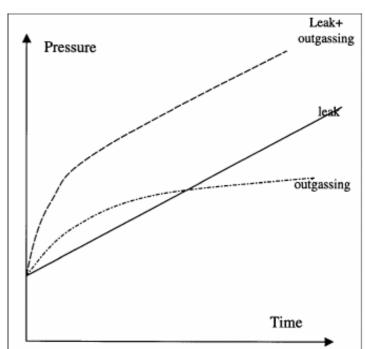
Phénomène inverse de l'adsorption : libération lente à basse pression des molécules adsorbées sur les surfaces

Comment le mesurer ?

test de remontée de pression

Application:

- choix des matériaux (surfaces lisses, non poreuses)
- sas introduction
- remise à Patm avec N_2 pour éviter O_2 et H_2O



évolution de la pression dans une enceinte isolée (pas de pompage)

Taux de dégazage spécifique

o après nettoyage et 100h de mise sous vide

```
Métaux (inox) qq. 10-8 Pa.m.s-1 (qq. 10-11 mb.l.s-1.cm-2)
```

élastomères qq.10-4 Pa.m.s-1

traitement thermique (étuvage 120°C)

```
    Métaux (inox)
    qq. 10-9 Pa.m.s-1
```

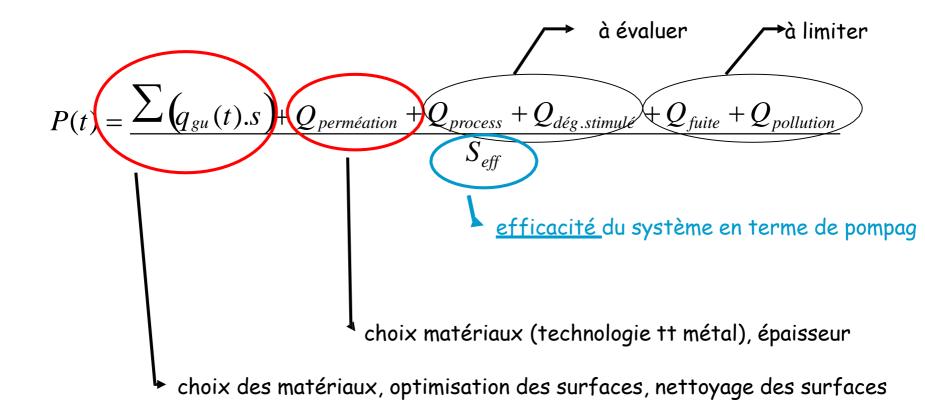
- élastomères (viton) qq.10-6 Pa.m.s-1
- o étuvage 300°C in-situ
 - Métaux (inox)
 qq. 10-11 Pa.m.s-1

Phénomène limitant l'obtention des basses pressions

Etuvage



Flux gazeux : conséquences sur la conception



Flux gazeux : conséquences sur la conception

On part de la relation:
$$P = \frac{Q}{S}$$
 Flux

Vitesse de pompage

$$Q = Q_{\text{fuite}} + Q_{\text{dégazage}} + Q_{\text{perméation}} + Q_{\text{rétrodiffution}}$$

$$Q_{\text{f}} \approx 0$$

$$Q_{\text{d}} = Q_{\text{dp}} + Q_{\text{dc}} + Q_{\text{di}} + Q_{\text{dd}}$$

 Q_{dp} : Désorption des gaz adsorbés physiquement en surface (chauffage à 100°C)

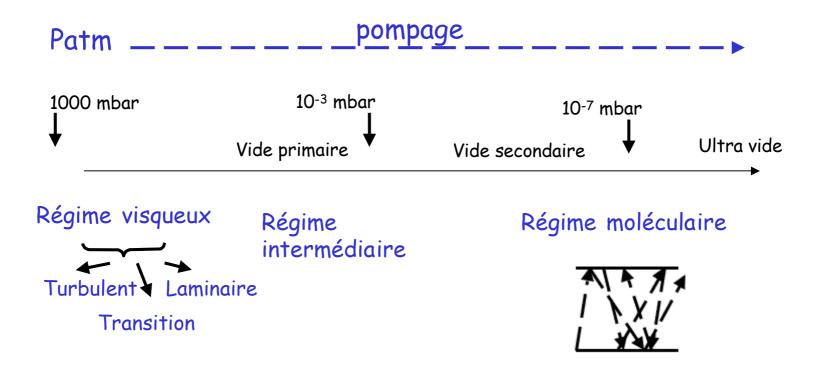
 Q_{dc} : Désorption à partir des gaz absorbés chimiquement (chauffage à 300, 400° C)

Q_{di} : diffusion des gaz à partir de l'intérieur du métal, Q_{di} augmente lorsque la température augmente

Q_{dd} : résultat de la décomposition des molécules adsorbées à la surface du métal par chimisorption. Ce sont surtout des oxydes qui restent stables aux températures habituelles d'étuvage (Q_{di} diminue si bombardement électronique, ionique, photonique,.....)

Q_p : faible pour les métaux (sauf Pd, Pt pour H₂ et He), grand pour le verre, quartz et constitue une limitation

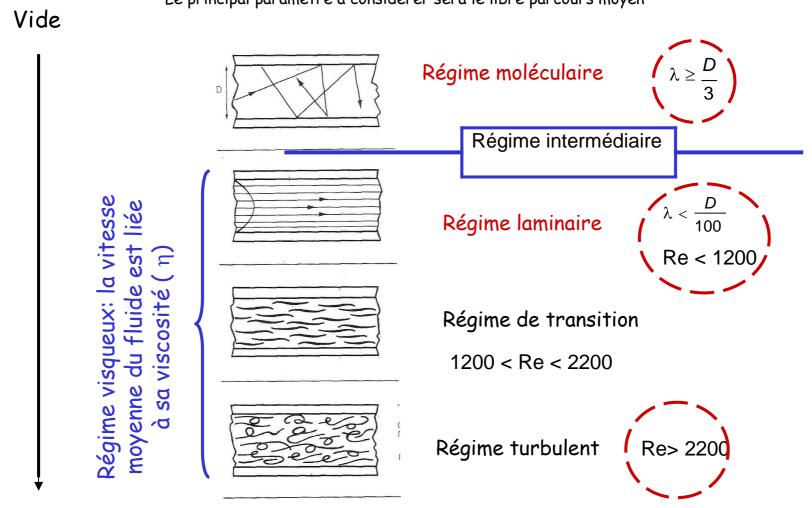
Les différents régimes



La valeur de la pression ne suffit pas à déterminer le régime, il faut tenir compte de la dimension des enceintes et canalisations, en particulier de leur diamètre.

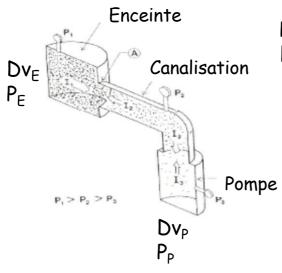
Comment caractériser ces régimes?

La perte de charge dans la canalisation ne provient plus de la viscosité du fluide. Les collisions avec les parois sont responsables de la résistance à l'écoulement. Le principal paramètre à considérer sera le libre parcours moyen



Pression atmosphérique

Vitesse de pompage effective et conductance



Pour une chambre reliée à une pompe, le flux Q qui circule est :

$$Q = P_E.Dv_E = P_P.Dv_P = C(P_E-P_P)$$

$$\frac{1}{Dv_E} = \frac{1}{Dv_P} + \frac{1}{C}$$

$$Dv_E = \frac{CDv_P}{Dv_P + C}$$

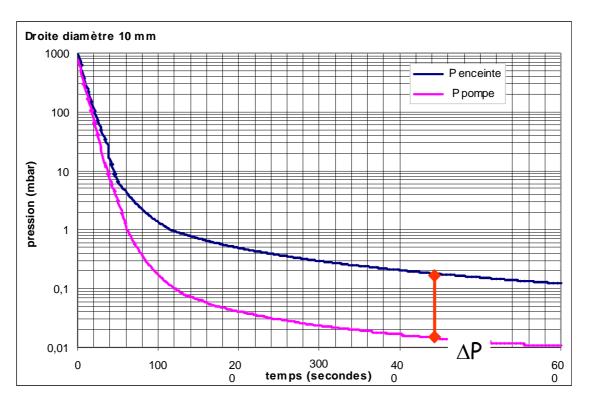
 Dv_P = débit volume intrinsèque de la pompe Dv_E = Vitesse de pompage effective

Lorsqu'une pompe est raccordée à une enceinte par l'intermédiaire d'une canalisation de conductance C, l'efficacité de la pompe est diminuée.

•si $C \approx \infty$ =>D $v_E \approx Dv_P$: faible perte de charge •si $C \leftrightarrow Dv_P$ => D $v_E \approx C$, $\forall Dv_P$: le pompage dans la chambre est faible même avec une pompe puissante

conductance : facteur limitant la vitesse de pompage effective

Effet d'une canalisation sur le pompage effectif

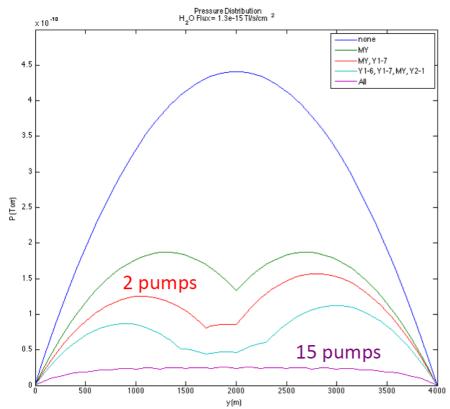


$$\Delta P = P_E - P_P = Q / C$$

Ecoulement du gaz et pompage réparti

Pour une géométrie fixée, ΔP ne dépend que du dégazage du tube

- réduire le taux de désorption (traitement de surface, conditions de propreté)
- pompage réparti (CERN NEG pump)
- nb de pompes



Exemple R&D tube Einstein Teslescope De 4 km de long

LEP vacuum chamber section

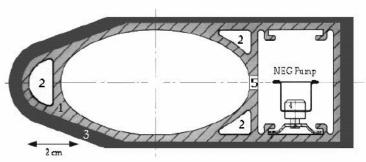
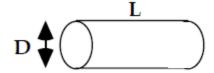


Fig. 2: Vacuum chamber section made of (1) extruded aluminium profile with the elliptic beam channel, three cooling water ducts (2) and surrounded by 3 to 8 mm thick lead shield (3). The NEG pump (4) is housed in a separate pump channel connected to the beam channel by a row of longitudinal slots (5).

Conductance



Définition

- On définit la résistance à l'écoulement d'un flux dans une canalisation par sa conductance C.
- La conductance d'une canalisation est le rapport entre le flux gazeux qui circule et la différence de pression entre les deux extrémités

$$C = \frac{Q}{P_1 - P_2}$$

En régime d'écoulement moléculaire utiliser des canalisations courtes et de grands diamètres pour optimiser les conductances

Le calcul d'une conductance nécessite de connaître le régime d'écoulement dans la canalisation

Régime moléculaire

s2: surface de la section

U : périmètre de la canalisation

L : longueur de la canalisation

$$C = \frac{16}{3} \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} \cdot \frac{s^2}{UL}$$

$$\frac{\overline{kT}}{2\pi m} \cdot \frac{s^2}{UL}$$
 C = 12, 1 $\frac{D^3}{L}$ pour l' air à 20°C

Régime intermédiaire

$$C = 12, 1 \frac{D^3}{L} \cdot J$$

$$J = \frac{1 + 271D \cdot \overline{P} + 4790(D \cdot \overline{P})^{2}}{1 + 3/6D \cdot \overline{P}}$$

Calcul du flux de dégazage total

$$Q_T$$
 = flux unitaire × surface

Vitesse effective de pompage

$$\frac{1}{S_{eff}} = \frac{1}{S_p} + \frac{1}{C}$$

Seff : vitesse effective de pompage au niveau de l'enceinte

Sp : vitesse de pompage au niveau de la pompe sans canalisation

C : conductance totale de la canalisation

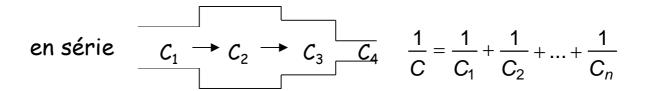
Vide limite

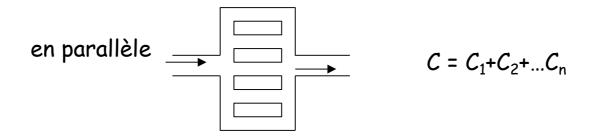
$$Q_T = PS_{eff} \Rightarrow P = \frac{Q_T}{S_{eff}}$$

$$\frac{1}{S_{eff}} = \frac{1}{S_p} + \frac{1}{C} \Rightarrow \frac{1}{S_{eff}} = \frac{C + S_p}{CS_p}$$

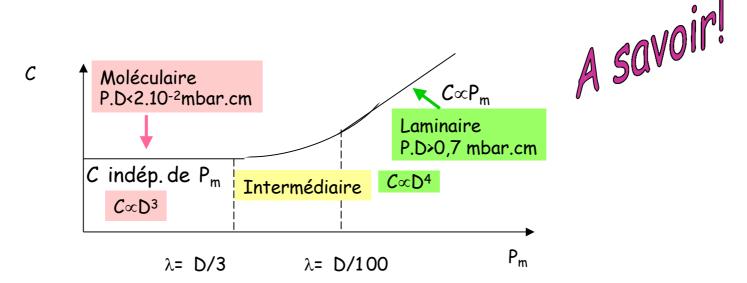
$$P = Q_T x \frac{C + S_p}{CS_p}$$

Lois pour un réseau complexe de canalisations





Résumé, conséquences



Régime moléculaire : C est indépendante de P, les collisions avec les surfaces sont responsables de la résistance au pompage

$$C = \frac{1}{6} \frac{D^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi kT}{m}}$$

Régime Laminaire: même lorsque la vitesse de pompage est constante (pompe), cette vitesse dépend de P_m au niveau du récipient

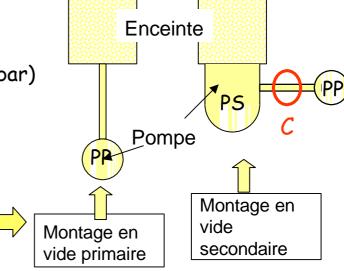
$$C = \frac{\pi D^4}{128 L \eta} P_m$$

Installations

les conductances en régime visqueux sont très supérieures à celles du régime moléculaire

- $\rightarrow \infty D_4 \setminus D_3$
- $\rightarrow \infty$ Pm (souvent supérieure à 1mbar)
- -> Coefficient supérieur

Peu d'effet en régime visqueux, au début du pompage mais les pompes secondaires sont montées directement sur l'enceinte (Cmax)



Variation des conductances en fonction des gaz :

- peu utile en régime visqueux
- · important en régime moléculaire : correction en fonction de

Ex:
$$C(H_2) = 3.8 C (air)$$

 $C(He) = 2.7 C (air)$
 $C(air à 77K) = 0.51 C (air à 293 K)$

L'ultra vide (UHV)

Conditionné par 3 facteurs :

- étanchéité parfaite : surfaces lisses sans défaut, joints cuivre écrasés
- •absence de dégazage : choix des matériaux (inox spécial), surfaces polies, étuvage pour effectuer le dégazage avant utilisation
- · propreté parfaite: précautions de manipulation

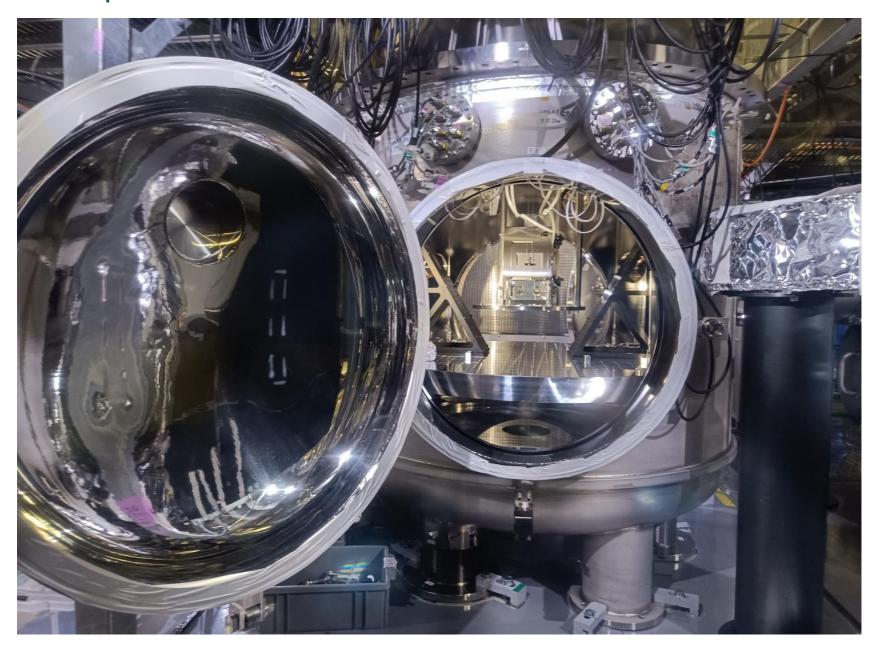
Etuvage:

- · chauffage par rubans, caissons, lampe IR
- · durée: 10 à 50 h
- température : 120 à 450 °C
- température uniforme nécessaire (point froid = condensation)
- · les pompes sont aussi étuvées

Rappel:

-à 10-8 mbar, il faut 100 s pour former une monocouche de contamination -à 10-10 mbar, il faut 3h...

Exemple chambre KAGRA



Les moyens de pompage

Caractéristiques principales des pompes à vide, critères de choix

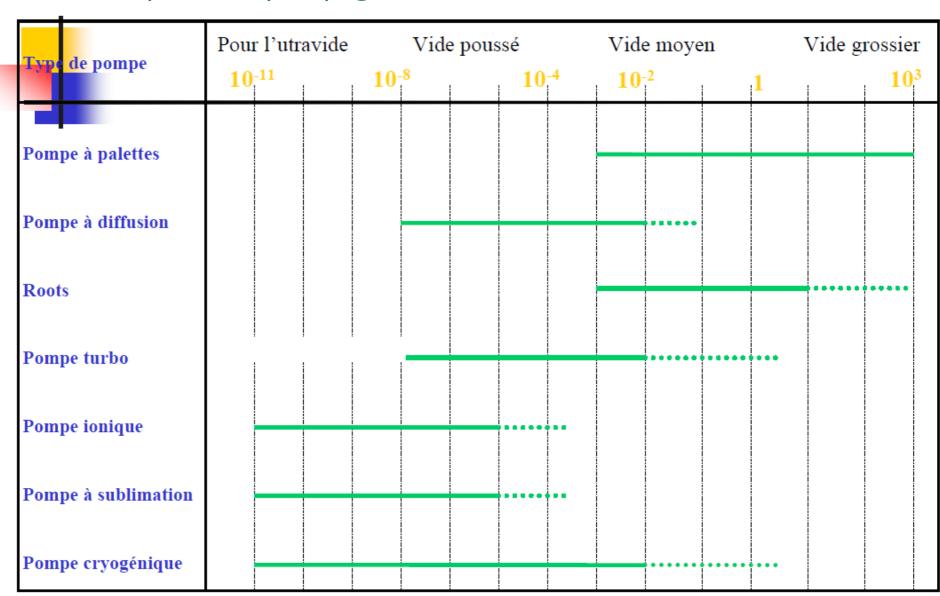
```
    ./ Le débit-volume q<sub>v</sub> = f(P, gaz)
    ./ La pression limite
    ./ La pression d'amorçage
    ./ Le taux de compression
        pompes à transfert de flux
        k = P<sub>ref</sub> / P<sub>asp</sub> = f (P, gaz)
    ./ Critères spécifiques au process
        • peu contaminante (technologie sèche)
        • pompage sélectif ou non
        • pas de vibration (paliers magnétiques)
```

•

coût (investissement, maintenance)

critères de maintenance (zone INB)

Les moyens de pompage



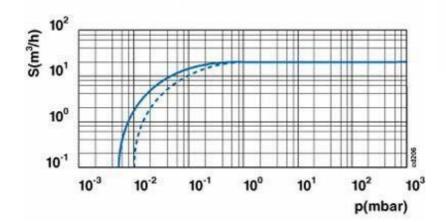
Zones de démarrage

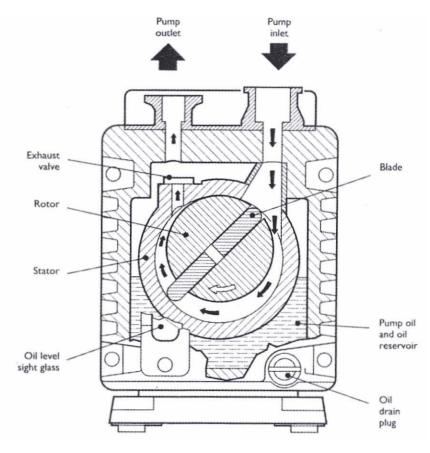
Les moyens de pompage: pompe à transfert

Pompe à palettes

Pompe volumétrique rotative

- Y P₁ ~10-1 Pa
- Y Non sélective
- Présence d'huile (joint dynamique, lubrifiant ,refroidissement)
- Y P_I limitée par Q_f et Q_{dég. Huile} (T!!)





• •

-fiable, faible coût



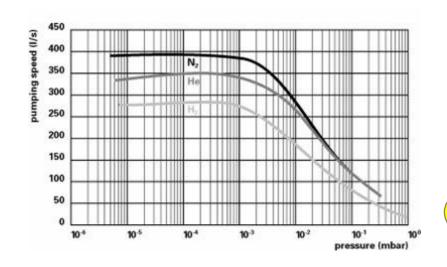
- présence d'huile

Les moyens de pompage: pompe à transfert

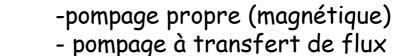
Pompes turbomoléculaires

Pompes cinétiques à parois mobiles

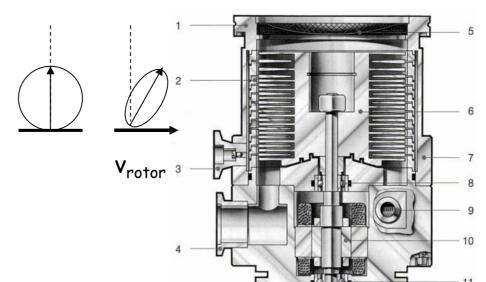
 $P_{\text{max}} \sim 1Pa \quad P_{\text{I}} \rightarrow \text{UHV}$ YK dépend de \sqrt{M} de v_{rotor} YCouplage à une pompe primaire







-évolution vers des pompes moins sélectives (H_2)

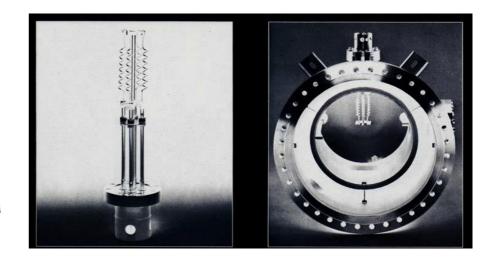


la pompe à sublimation de titane

Principe : un film de Titane sublimé est déposé sur une paroi et capture par chimisorption les particules gazeuses (formation d'un composé chimique stable -hydrure, nitrure, oxyde)

Les gaz nobles sont mal pompés (physisorption ou enterrement)

- pompe sèche débits volumes importants simple
- très sélective filament chauffé remontée de pression au flash



la pompe à getter (non évaporable)

- Pompage par adsorption sur un matériau getter suivi d'une diffusion dans le matériau.
- getter sous forme de ruban (alliage 84% Zr 16% Al)
- le getter est activé à haute température par effet joule $(700^{\circ}C)$ puis $400^{\circ}C)$
- les gaz rares et CH₄ ne sont pas pompés



H₂ pour UHV



- vide propre,
- simple
- intégrable (pompage réparti)



- faible q_v saturation
- activation à haute T°
- très sélective

la pompe ionique



Pompe utilisée en ultra vide, s'amorce en vide secondaire donc couplée à un groupe primaire+ secondaire (PTM par ex.)

 $P_{\text{max}} \leftrightarrow 10^{-4} \text{ Pa}$ 10⁻⁴ à 10⁻¹² mbar



- vide propre, pas de vibration

- maintenance, mesure de P



- faible q_v , pompe lourde
- durée de vie $\propto P^{-1}$
- effet mémoire

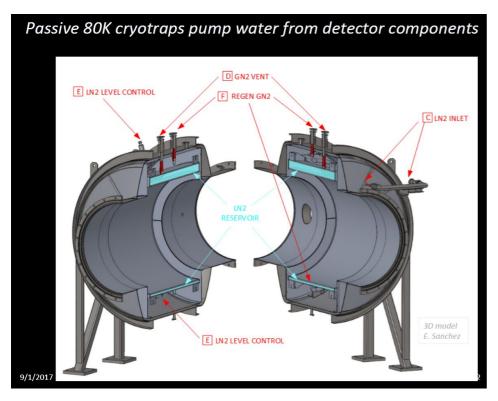
Dv faibles: ex 25 l.s-1

Sélectives : bonne pour H_2,O_2,H_2O , moins

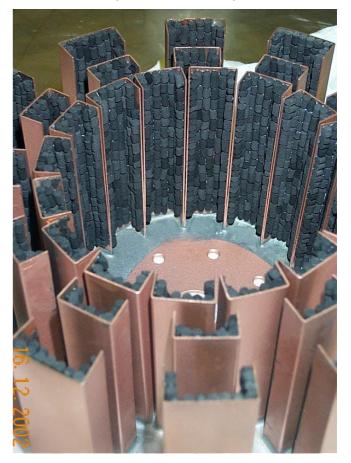
pour He, Ne, pompe mal Ar

le cryopompage

- condensation
- cryosorption sur adsorbants solides refroidis (physisorption)
- cryotrapping



Cryosorption de l'H₂ sur charbon actif refroidi à 20 K (couplage thermique par collage sur la source cryogénique) Étage 20K sur cryopompe DN 800 (CSS - Ganil)



le cryopompage : sources froides

fluides cryogéniques (LHe,LN2)

- puissance cryogénique, fiabilité
- gestion des cryofluides

cryogénérateurs : détente d'hélium associée à une circulation sur des regénérateurs + autonomie

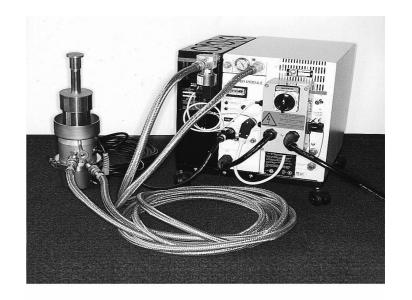
- vibrations
- puissance limitée (12W@20K)



q, élevé



regénération, vibrations, q, He



Caractéristiques d'une pompe cryogénique

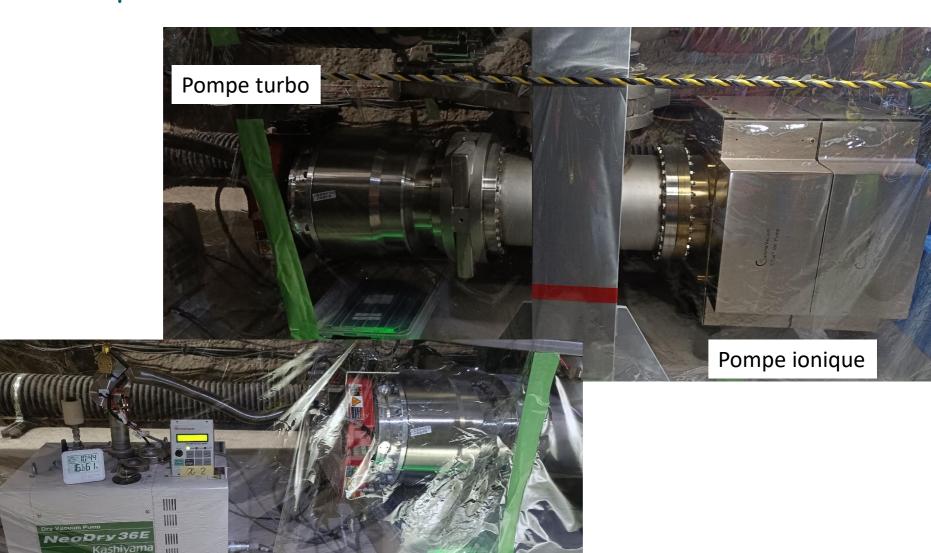
- •gamme de fonctionnement : 10-3 > P > 10-10 mbar
- ·P élevée: la paroi est réchauffée par le gaz et la saturation est rapide
- · pompe primaire nécessaire
 - pour abaisser pression dans la pompe avant mise en froid
 - pour abaisser P de l'enceinte sous 10-3 mbar

Ensuite, la pompe cryogénique peut être isolée (pas de transfert)

- régénération nécessaire : capacité de piégeage finie, l'épaisseur du
 "condensat" augmente, créant un gradient de température, la pompe est saturée et doit être réchauffée sous pompage
- débit volume dépend de la nature du gaz, très efficace pour vapeur d'eau air : 1000 litres/s argon : 600 l/s
 eau : 3 à 4000 l/s H₂ : 600l/s
- efficace pour de forts débits à P< 10-6 mbar
- vide propre
- peut être « empoisonnée » si remontée de pression => régénération
- · utilisée en fonctionnement continu
- vibrations basse fréquence

Exemple installation tube KAGRA

Pompe sèche



Mesure du vide

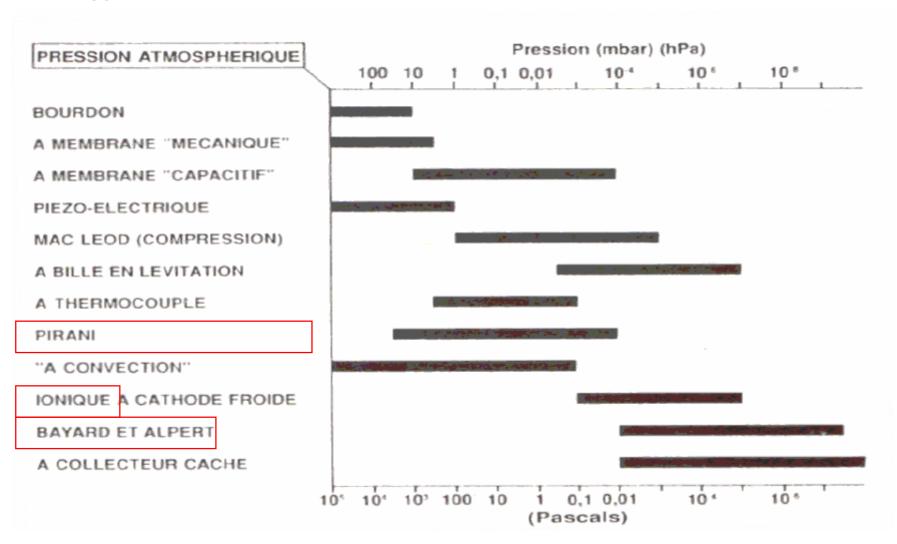
Qu'est-ce qu'on mesure?

- directement la pression (capteur vrai)
- une propriété du gaz (le plus souvent)
- une pression qui ne dépend pas de la nature du gaz (capteur absolu)
- une pression qui dépend du gaz (capteur relatif, étalonné pour N2)
- · la pression totale
- · les pressions partielles : spectrométrie de masse

Remarques:

- ·L'étendue de la gamme des pressions à mesurer (15 décades de Patm à UHV) implique l'utilisation de plusieurs types de capteurs
- ·les capteurs de vide sont plus de bons indicateurs du niveau de vide que des instruments de métrologie
- •à basse pression, la mesure de la pression se fait avec les capteurs à ionisation dont l'indication dépend de la nature du gaz (la sensibilité peut varier d'un facteur 10, ils sont étalonnés pour N_2)

Type de manomètres



Manomètre à effet mécanique

manomètres de Bourdon

P* > 1 hPa

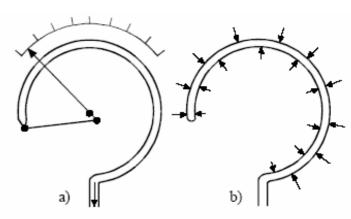
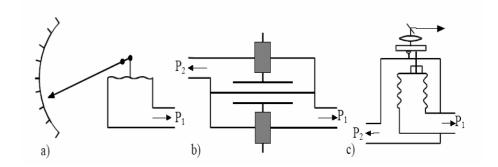


Fig. 2 Bourdon gauge, a) principle, b) distribution of forces

à membrane piézorésistif (dépôt Si) capacitif

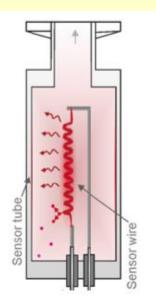


Manomètre thermique: la jauge de Pirani

C'est une jauge à filament (W, Pt) alimenté à courant constant. La diminution des échanges thermiques lorsque P diminue se traduit par une variation de sa résistance.

gamme: 50 - 10-3 hPa

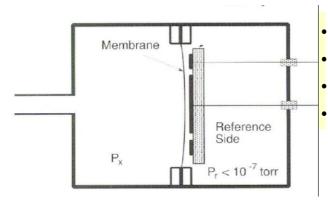
- •capteur de vide primaire : de 60 mbar à 10-3 mbar
- •capteur relatif : la sensibilité du capteur varie en fonction de la nature du gaz, étalonné pour N_2 en général (correction pour H_2 =0,67, pour Ar=1,58)
- · capteur robuste, indicateur du niveau de vide



Capteur à membrane

- •principe basé sur la déformation d'une membrane suite à une différence de pression par rapport à une pression de référence
- · capteur vrai, absolu
- capteur très sensible, rapide, robuste (gaz corrosifs)

Capteur à membrane capacitif
$$C = \frac{\varepsilon.S}{d}$$
 Variation de d en fonction de P



Très utilisé

grande dynamique : 4 décades de pression

· gamme: 10³ à 10⁻⁴ mbar, selon membrane

seul capteur précis entre 10-1 et 10-4 mbar

Autre type: piézorésistif : membrane en matériau à fort effet piézorésistif (Si dopé) Inconvénient : dérive thermique

Principe: ionisation du gaz résiduel

- ⇒ mesure la densité du gaz
- \Rightarrow mesure d'un courant ionique proportionnel à la pression : i+ \propto K P i-
- ⇒ dépend de la nature du gaz (probabilité d'ionisation)

Capteur ionisation - Bayard-Alpert

- capteur sensible, précis
- gamme de pression: 10-4 10-10 mbar
- étalonné pour N2 (sensibilité varie en fonction de la nature des gaz)
- défaut : fragilité due au filament chaud, ne supporte pas les remontées de pression
 doit être dégazé : il se forme une couche de
- gaz adsorbés sur l'anode qui peuvent être désorbés sous forme d'ions (fluctuations)





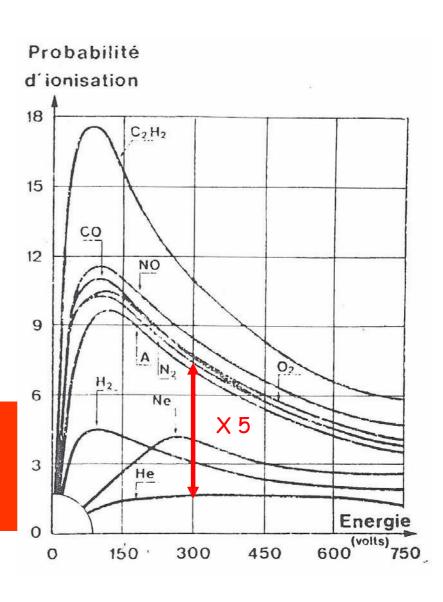
Inconvénient: pour P< 10-10 mbar, les e-émis par la cathode libèrent des X mous qui créent des photoélectrons. Ceux-ci induisent un courant "positif" ou "négatif" au collecteur.

Sensibilité des manomètres à ionisation suivant la nature du gaz

Si gaz résiduel 100% He $P_{\text{vraie}} = P_{\text{lue}} \times 5$



Nécessité de connaître la nature du gaz résiduel Tenir compte du facteur de sensibilité de la jauge



Spectromètre de masse en techniques du vide Analyseur de gaz résiduel (RGA)

Mesure du vide

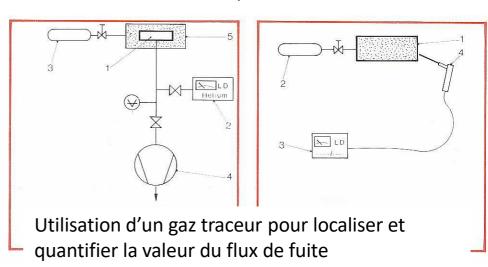
- ·les pompes aspirent chacun des gaz comme s'ils étaient seuls et sont plus ou moins sélectives
- modification de la composition le long d'une ligne de pompage (conductances)
- ·la mesure de la pression totale donne la somme de toutes les pressions partielles, gaz parfaits et vapeurs condensables

Contrôle de procédés

- · déterminer les sources de pollutions, de dégazage, de fuites
- · caractériser des réactions (décomposition, traitement thermique...)

! temps de réponse

$$\theta_{63\%} = \frac{V}{S_{He}}$$



Pression partielle du composant n

$$P_n = \frac{I_n^+}{S_n}$$

I $_n$ = courant ionique mesuré du composant $_n$ = sensibilité de l'appareil pour le gaz $_n$

H2O 2.10⁻⁴ A.mb⁻¹ N2 2.10⁻⁴ A.mb⁻¹ O2 1,4.10⁻⁴ A.mb⁻¹

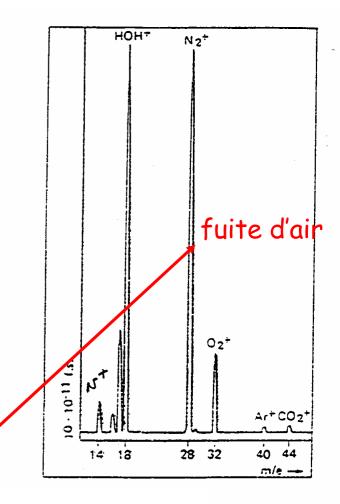
P₁₈: 5.10⁻⁷ mb

 $P_{N2} / P_{N2} + P_{O2} = 78\%$

 $P_{28}: 5.10^{-7} \text{ mb}$

 $P_{O2} / P_{N2} + P_{O2} = 21\%$

 $P_{32} : 1,4 \ 10^{-7} \ mb$



Quelques références

P. Dolégiéviez - Le vide - Ecole des accélérateurs — Novembre 2007 Christian GIANESE — Institut NEEL Simone CASSETTE — Polytech 2011 Ludovic SALVAGNAC — Le vide Bruno MERCIER — Le degazage — Lille - 2011

G. Rommel. Les Techniques de l'Ingénieur B4020 à B4120. Paris.

